

Porte-Panier De Nettoyage De Laboratoire Ptfé Personnalisé, Support De Wafer À Haute Pureté Résistant Aux Acides Et Bases, Rack De Bain Chimique À Faible Fond Et Sans Contamination

Numéro d'article: PL-CP268



Introduction

Découvrez nos porte-paniers de nettoyage PTFE personnalisés à haute pureté, conçus pour la semi-conducteur et l'analyse de traces. Ces racks résistants aux acides garantissent un lessivage nul et des niveaux de fond ultra-faibles, offrant des performances fiables dans les environnements chimiques les plus exigeants pour les processus de nettoyage de laboratoire de précision.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Nettoyage de wafers semi-conducteurs	Maintien sécurisé des wafers de silicium lors des processus de nettoyage RCA ou de gravure HF dans les environnements de salle blanche.	Empêche la contamination métallique et assure une exposition chimique uniforme.
Analyse de métaux traces	Nettoyage et lessivage de la verrerie utilisée pour la préparation d'échantillons ICP-OES et ICP-MS pour atteindre une pureté de niveau ppt.	Élimine les interférences de fond provenant du matériau du récipient lui-même.
Recherche sur les batteries	Manipulation des matériaux d'anode et de cathode lors des phases d'immersion dans l'électrolyte ou de traitement chimique.	Résistance aux solvants organiques agressifs et aux sels de lithium.
Stérilisation pharmaceutique	Transport de flacons en verre ou de composants de précision à travers des cycles de stérilisation à haute température ou chimiquement agressifs.	Maintient la pureté et empêche l'adsorption de surface des ingrédients actifs.
Dégraissage de composants aérospatiaux	Maintien de pièces d'alliage usinées avec précision lors de cycles de nettoyage en profondeur dans des dégraissants chimiques harsh.	Durabilité à long terme dans les réactifs de nettoyage de force industrielle.
Fabrication de cellules solaires	Support des substrats photovoltaïques lors du traitement chimique humide et des étapes de texturation.	Haute résistance thermique et compatibilité chimique avec les agents de gravure.
Préparation d'échantillons géologiques	Digestion et nettoyage d'échantillons minéraux utilisant de l'acide fluorhydrique concentré pour la détermination des éléments.	Manipulation sûre dans les environnements acides dangereux sans dégradation du récipient.

Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP268	Valeurs / Capacités
Propriétés du matériau	Matériau de construction principal	PTFE vierge à haute pureté (Polytétrafluoroéthylène)
	Fond d'éléments traces	Ultra-faible (Convient pour une analyse de niveau PPT)
	Résistance chimique	Universelle (Sauf métaux alcalins fondus/fluor)
	Absorption d'eau	<0,01%
Dimensions physiques	Configuration	Entièrement personnalisable selon les spécifications du client
	Options de taille	Conceptions sur mesure pour wafers de 2", 4", 6", 8", 12" ou verrerie personnalisée

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP268	Valeurs / Capacités
	Fonctions de manipulation	Poignées intégrées en option, bras extensibles ou couvercles verrouillables
Limites thermiques	Température de fonctionnement maximale	260°C (500°F)
	Température de fonctionnement minimale	à -200°C (-328°F)
Détails de fabrication	Méthode de fabrication	Usinage CNC de haute précision
	Rugosité de surface	Ra 0,4 - 0,8 µm (Standard) / Options polies disponibles
	Référence de l'article	PL-CP268